



報道発表

半導体業界の著名人 BALA THUMMA 氏が D2S の副社長に就任

Bala Thumma 氏は、あらゆるマスク（曲線を含む）の描画におけるパターンの忠実度と精度を向上させる D2S の GPU アクセラレーションによるピクセル レベル ドース コレクション (PLDC) 技術を担当します。

2024 年 9 月 10 日 アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ市 発

半導体製造向けの GPU アクセラレーション ソリューションのサプライヤーである D2S 社は本日、半導体業界の著名人で、元シノプシス社の上級幹部である Bala Thumma 氏がピクセル レベル ドース コレクション (PLDC) 担当副社長として入社したことを発表しました。25 年を超えるソフトウェア、半導体製造、電子設計自動化 (EDA) の経験を持つ同氏は、D2S の PLDC ソリューションの開発とカスタマ・リレーションを推進します。

マスク作成における PLDC は、マルチビーム・マスク・ライターに適用される技術であり、形状を調整するのではなく、個々のピクセルのドース量を操作することでパターンの忠実度と精度を向上させます。この補正方法は、エッジのコントラストとプロファイルを改善し、データをエッジベースの輪郭形状に変換し直すことなく、ラインエンドの短縮や CD エラーなどの問題に対処します。PLDC は GPU 上で動作し、高速処理が可能で、従来のマンハッタン・パターンを含むあらゆるパターンを修正するのに非常に効率的であり、たとえ曲線パターンであっても実行時間が延びることはありません。

D2S の CEO である藤村 晶氏は、次のように述べています。「私は長年にわたりフォトマスク業界で Thumma 氏と仕事をする機会に恵まれました。私と彼は、最初は EDA の自動配置配線ソフトウェアから始まり、その後、半導体製造用ソフトウェアに移ったという似た経歴を持っており、カスタマの先にいるエンドカスタマの技術とニーズを理解することで、製造業のお客様により良いサービスを提供できるようになると考えています。彼には、革新的なソリューションを提供する当社の能力を高めるだけでなく、半導体業界全体にマスク製造の重要性を認識させる上でも貢献を期待しています。」

Bala Thumma 氏は次のように述べています。「私は D2S に入社し、半導体製造における最先端ノード向けツールの構築において技術革新の最前線に立つチームの一員になれることを嬉しく思っています。PLDC テクノロジーは、GPU アクセラレーションを活用してパターンの忠実度と精度を向上させることで、マスク作成における大きな進歩を実現します。私は長年にわたり、半導体製造業界の第一人者として藤村 晶氏を知っており、この技術を前進させ、お客様がより高い精度と効率により、高度な半導体設計に対するますます高まる需要に応えられるようにするために、藤村氏と D2S の優秀なチームと共に働けることを楽しみにしています。」



Thumma 氏はフォトマスク コミュニティの重鎮で、10 年以上にわたって BACUS 運営委員会に所属し、Curvilinear フォーマット運営グループでも活動しています。同氏は、D2S 入社前は、Synopsys 社に 20 年間勤務し、シリコン エンジニアリング グループのシニア ディレクターなどの要職を務め、マスク データ生成の市場リーダである Synopsys 社の Computer Aided Transcription System (CATS) ソフトウェア製品の開発を統括しました。キャリアの初期には Intel 社に在籍し、社内の自動配置配線ツールの設計、開発、導入を主導しました。それ以前は、VLSI Technologies の子会社である Compass Design Automation で自動配置配線に携わっていました。

Thumma 氏は、国立工科大学ワランガル校で電子通信工学の学士号、南イリノイ大学エドワーズビル校でコンピューターサイエンスの修士号、アリゾナ州立大学 W. P. キャリー・スクール・オブ・ビジネスで MBA を取得しました。同氏は、IC 設計におけるタイミング ドリブンのエンジニアリング チェンジ オーダーに関する多数の特許を保有しています。

D2S 社について

D2S 社は、GPU により高速化された半導体製造向けのソリューションを提供する会社です。同社は、大手の装置パートナーにシミュレーションベースのカスタムソリューションを提供し、フォトマスクおよびウェハーメーカーには D2S TrueMask®ソリューションを提供しています。D2S 社の TrueMask ソリューション群は、自社の計算設計プラットフォーム (CDP) を用いる事により、優れたウェハー品質が得られる複雑な多頂点図形や曲線図形を有するフォトマスクを実用的で費用効果に優れたマスク描画時間内で実現することを可能にしています。D2S 社は、eBeam Initiative の幹事会社であり、また電子機器製造における深層学習センター (CDLe) の創設メンバーでもあります。同社の本社はカリフォルニア州サンノゼ市にあり 2007 年に設立されました。詳しくは、www.design2silicon.com をご覧ください。

D2S, D2S ロゴ、そして TrueMask は D2S 社の登録商標です。

お問い合わせ先： オープンスカイコミュニケーションズ社 (Open Sky Communications)

主任 (Principal) デーヴィッド モレノ (David Moreno)

電話： (米国) 415-519-3915

電子メール： dmoreno@openskypr.com

###